

第14章 知的財産権

1. 知的財産権保護の状況

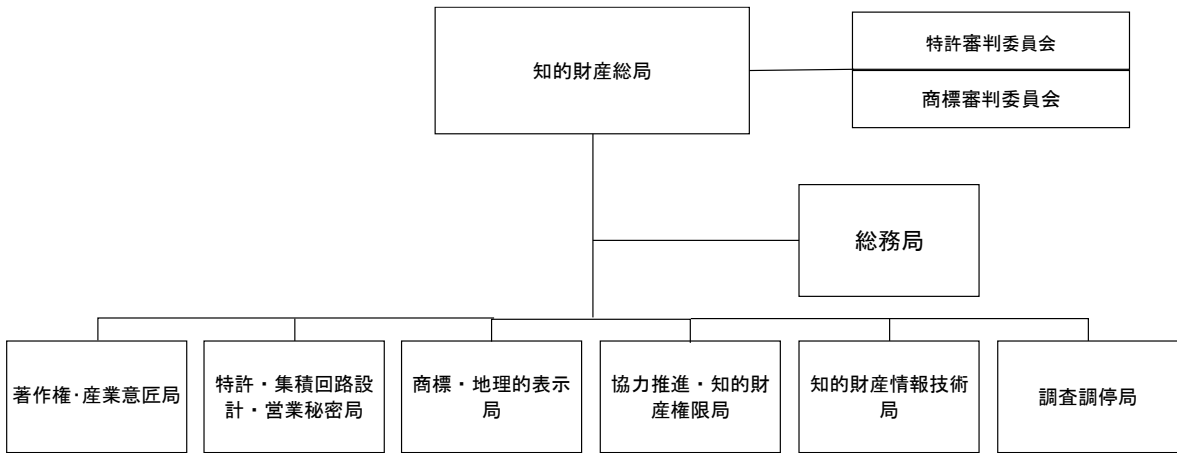
インドネシアは、工業所有権の国際的保護を目的とするパリ条約や、複数の国々での特許取得簡素化を図る特許協力条約（Patent Cooperation Treaty：PCT）、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS 協定）などの国際条約を批准し、特許や商標など知的財産権の保護に取り組んでいる（図表 14-1）。インドネシアの知的財産権の所管は法務・人権省知的財産総局（図表 14-2）である。ただし、植物新品種に関する知的財産権は、農業省植物品種保護センターが所管している。

図表 14-1 インドネシアが加盟する知的財産権関連の条約・機関

加盟条約・国際機関	加盟日
パリ条約	1950 年 12 月
ヘーグ条約 ロンドンアクト	1950 年 12 月
世界知的所有権機関（WIPO）	1979 年 12 月
世界貿易機関（WTO）	1995 年 1 月
ベルヌ条約	1997 年 9 月
商標法条約（TLT）	1997 年 9 月
WIPO 著作権条約	2002 年 3 月
WIPO 実演・レコード条約	2005 年 2 月
マドリッドプロトコル	2018 年 1 月

（出所）特許庁（日本）、JETRO「模倣対策マニュアル」より作成

図表 14-2 知的財産総局の組織



（出所）知的財産総局より作成

2. インドネシアで保護される知的財産権

インドネシアの現行の知的財産権関連の法律と保護される対象は図表 14-3 の通りである。

図表 14-3 インドネシアで保護される知的財産権の概要

	法律（施行）	所管	登録要件/ 保護対象	保護期間
特許	改正 特許法 (2024/10/28)	法務省 知的財産総局	新規性、進歩性、産業上利用性	出願から20年
簡易特許 (実用新案)	改正 特許法 (2024/10/28)	法務省 知的財産総局	形状、形態、構造またはそれらの組み合わせにより実用的価値を有する物品の発明で新規なもの	出願から10年
産業意匠	産業意匠に関する 法律第31号 (2000/12/20)	法務省 知的財産総局	新規性	出願から20年
商標	商標及び地理的表示 に関する法律第8号 (2016/11/25)	法務省 知的財産総局	商品またはサービスに使用する 商標および地理的表示・原産地 表示	出願から10年 (10年毎に更新可)
著作権	改正 著作権に関する 法律第19号 (2014/10/16)	法務省 知的財産総局	文字/口頭で表現された著作 物、視覚教材、あらゆる芸術作 品等、翻訳、ビデオゲーム、隣 接権（実演家、製作者、放送業 者）	最初の公表から 70年
集積回路配置	集積回路配置設計に 関する法律第32号 (2000/12/20)	法務省 知的財産総局	新規性	最初の商業使用また は出願日の早い方か ら10年間
植物新品種	植物品種保護法 (2000/12/20)	農業省植物品種 保護センター	種苗、収穫物	出願から20年 (樹木は25年)
営業秘密	営業秘密に関する 法律第30号 (2000/12/20)	法務省 知的財産総局	秘密性を有し、経済的価値があ り、当然取られるべき方法で秘 密性が維持されている情報	—

（出所）JETRO「模倣対策マニュアル」を基に作成

(1) 特許

インドネシアにおいて特許は、2024 年制定の改正特許法により保護される。特許の保護期間は出願から 20 年間であり、法律や宗教規範・公序良俗に反する場合や、生物（微生物を除く）などは特許の対象とは認められない。ただし、遺伝的資源に係る発明は特許の対象として認められる。

また、インドネシアは特許協力条約（PCT）に加盟しているため、国際出願を行うことが可能である。インドネシアの特許取得手続概要は図表 14-4 の通りである。

図表 14-4 特許取得手続概要

特許出願	インドネシア語で作成した願書および必要書類を提出
↓	
方式審査	出願書類が必要要件を満たしているかを審査
↓	
出願公開	方式審査の後、出願から18ヵ月後に公開
↓	
実体審査	不特許事由にあたらないか、新規性・進歩性の有無等を審査
↓	
登録	拒絶理由が発見されなければ、特許として登録される

(出所) 各種資料より作成

特許法では、特許のほかに「簡易特許」の保護も規定されており、2020年には公開時期や実態審査期間が変更されている。「簡易特許」は、形状、形態、構造またはその組み合わせにより実用的価値を有し、新規で実用的なものを対象とする。

特許との主な相違点は以下の通り。

- ・ 保護期間は出願から10年（※特許では20年）
- ・ 公開時期は出願から14営業日以内（※特許では18ヵ月後）
- ・ 実体審査期間は出願から6ヵ月以内（※特許では30ヵ月以内）

知的財産総局により公表されている特許及び簡易特許に関する情報を図表 14-5 に示す。2023年の特許の出願件数総数を国別で見ると、米国が最も多く、インドネシアは3位であった（図表 14-6）。

図表 14-5 インドネシアの特許・簡易特許の出願と登録件数

出願年	特許	
	出願	登録
2019	11,524	10,532
2020	8,205	8,005
2021	8,847	6,870
2022	10,024	9,993
2023	10,598	6,447

(出所) World Intellectual Property Organization より作成

図表 14-6 国別特許出願件数（上位 4 カ国：2023 年）

順位	国名	件数
1	米国	2,040
2	日本	2,009
3	インドネシア	1,682
4	中国	1,288
-	その他	3,535

（出所）World Intellectual Property Organization より作成

(2) 産業意匠

インドネシアでは 2000 年 12 月 20 日より第 31 号産業意匠法が施行されている。産業意匠の保護期間は 10 年間で、延長はされない。出願後、書類の不備などのチェックを行う方式審査を経て、公共の秩序、宗教・道徳に反しないことがチェックされた後、出願が公開される。規定上は、異議申立がなければ実体審査は行われないとされているが、運用上の問題もあり、実際には全て審査が行われている模様である（手続きについては図表 14-7 参照）。知的財産総局により公表されている産業意匠に関する情報を図表 14-8 及び図表 14-9 に示す。

図表 14-7 産業意匠登録手続概要

意匠出願	インドネシア語で作成した願書および必要書類を提出
↓	
方式審査	出願書類が必要要件を満たしているかを審査
↓	
公序良俗 チェック	公序良俗や新規性等についての要件を満たしているかを審査
↓	
出願公開	実体審査の後、出願公告（通常は出願から3ヵ月以内）
↓	
実体審査	異議申し立てがあった場合に実施
↓	
登録	実体要件を満たしていれば、意匠登録される

（出所）各種資料より作成

図表 14-8 産業意匠出願数と登録数

出願年	出願件数	登録件数
2019	2,755	4,140
2020	3,558	1,061
2021	4,400	2,306
2022	4,926	1,997
2023	6,476	4,726

(出所) World Intellectual Property Organization より作成

図表 14-9 国別産業意匠出願件数（上位 4 カ国：2023 年）

順位	国名	件数
1	インドネシア	4,795
2	中国	438
3	米国	265
4	日本	258
-	その他	570

(出所) World Intellectual Property Organization より作成

(3) 商標

インドネシアでは、2016 年 11 月 25 日施行の商標及び地理的表示に関する法律により、商標権は保護される。保護される期間は 10 年間で、10 年ごとに更新が可能である。法律や宗教規範・公序良俗に反する標章や、識別性がなく既に公共財産となっているような標章などは登録の対象とならない。商標登録手続の概要は図表 14-10 参照のこと。

図表 14-10 商標登録手続概要

商標出願	インドネシア語で作成した願書および必要書類を提出
↓	
方式審査	出願書類が必要要件を満たしているかを審査
↓	
出願公告	拒絶理由にあたらなければ出願公告
↓	
実体審査	絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由に関する審査
↓	
登録	異議申し立てがなければ商標登録

(出所) 各種資料より作成

知的財産総局により公表されている商標に関する情報を図表 14-11 及び図表 14-12 に示す。

図表 14-11 商標出願件数

出願年	出願件数	登録件数
2019	92,685	49,330
2020	127,081	220,859
2021	130,221	177,854
2022	142,681	127,671
2023	155,450	130,832

(出所) World Intellectual Property Organization より作成

図表 14-12 国別商標出願件数（上位 4 カ国：2023 年）

順位	国名	件数
1	インドネシア	112,330
2	中国	6,758
3	米国	2,634
4	シンガポール	1,923
-	その他	10,170

(出所) World Intellectual Property Organization より作成

(4) 著作権

インドネシアの著作権は、2014 年 10 月 16 日施行の改正著作権法に規定される。権利発生自体には特段の手続きは必要ないものの、権利を行使するにあたっては登録した方が良いといわれる。

保護の対象は、以下の①～⑧である。

- ① 文字で書かれた著作物
- ② 講演など口頭での著作物
- ③ 視覚教材
- ④ 歌、音楽、演劇、絵画、映画、写真などの芸術作品
- ⑤ 翻訳
- ⑥ 創作またはデータの集積（デジタルフォーマットを含む）
- ⑦ 伝統的表現の集積
- ⑧ ビデオゲームなど

出願にあたっての書類は、インドネシア語で作成する必要がある。著作物の見本とともに願書を知的財産総局に提出する。知的財産総局が公表する著作権に関する情報を図表 14-13 に示す。

図表 14-13 著作権申請数

出願年	国内	国外
2019	42,172	82
2020	58,042	73
2021	83,041	87
2022	116,986	137
2023	141,847	情報なし

(出所) 知的財産総局 (2023 Annual Report)

(5) 集積回路配置

インドネシアでは 2000 年 12 月 20 日施行の集積回路配置設計に関する法律により、集積回路配置の保護が規定されている。保護期間は、最初の商標使用日または出願日のいずれか早い方から 10 年間であり、実体審査は行われない。

3. 日・インドネシア経済連携協定

2008 年 7 月 1 日、貿易・投資の自由化、円滑化の推進や、互恵的経済連携構築により経済の活性化を図ることを目的に、「日・インドネシア経済連携協定 (JIEPA)」が発効された。JIEPA には、両国での知的財産権保護に関する項目が盛り込まれている。その後、2024 年 8 月に、「日・インドネシア経済連携協定 (JIEPA) 改正議定書」が発効され、自動車及び鉄鋼製品の関税撤廃や引下げ等の市場アクセスの改善に関する事項も定められた。

JIEPA に盛り込まれている知的財産権保護に関する内容は以下の通りとなっている。

【総論】

- ・ 知的財産（特許、意匠、商標、著作権及び関連する権利、植物の新品種、不正競争の防止など）の十分、効果的かつ無差別的な保護の確保（内国民待遇・最恵国待遇の原則に基づく知的財産の保護）
- ・ 知的財産分野での協力及び協議メカニズム

【各論】

- ・ 知的財産関連手続の簡素化・透明化
 - ① 公証義務の原則禁止
 - ② 包括委任状制度の導入など
- ・ 知的財産の保護の強化
 - ① 特許審査・審判結果の提供に基づく早期審査制度の導入
 - ② 部分意匠保護制度の導入
 - ③ 外国周知商標保護制度の導入
 - ④ 不正競争行為の禁止など

- ・ 権利行使の強化
 - ① 税関差止め対象を輸出品に拡大
 - ② 著作権侵害物品の積み戻し禁止対象化など